

权 利 要 求 书

1. 一种反应腔室，其特征在于，包括：

腔体，所述腔体接地；

5 上盖，所述上盖与电极电连接，所述腔体与所述上盖通过绝缘部相连，且所述腔体与所述上盖形成内腔，所述上盖开设有与所述内腔连通的通孔；

进气机构，所述进气机构包括至少部分设置在所述通孔中的绝缘主体，所述绝缘主体中设置有进气通道，所述绝缘主体的背离所述内腔的一侧设置有法兰部件，所述法兰部件接地，且用于将所述进气通道的进气端与用于输
10 送反应气体的进气管的出气端相连通；所述进气通道的出气端与所述内腔相连通；并且，所述进气通道包括至少两个在所述通孔的轴向上依次连通的通道段，且任意相邻两个所述通道段在垂直于所述通孔的轴向上的平面上的正投影相互错开。

15 2. 根据权利要求 1 所述的反应腔室，其特征在于，所述绝缘主体包括在所述通孔的轴向上依次设置的至少两个绝缘块，每个所述绝缘块均设置有用作所述通道段的进气孔。

3. 根据权利要求 2 所述的反应腔室，其特征在于，所述绝缘块为两个，
20 分别为靠近所述内腔的第一绝缘块和背离所述内腔的第二绝缘块，其中，所述第一绝缘块开设有用作所述通道段的第一进气孔，且所述第一绝缘块的背离所述内腔的一侧开设有容纳空间，所述第二绝缘块设置在所述容纳空间中，且所述第二绝缘块开设有用作所述通道段的第二进气孔。

25 4. 根据权利要求 3 所述的反应腔室，其特征在于，所述第二绝缘块的外周面开设有进气槽，所述进气槽与所述容纳空间的内壁形成所述第二进气孔。

5. 根据权利要求 4 所述的反应腔室，其特征在于，所述第二绝缘块朝向所述内腔的一侧开设有第一凹槽，所述第一凹槽与所述容纳空间的内壁形成第一气腔，所述第一进气孔和所述第二进气孔均与所述第一气腔连通。

5

6. 根据权利要求 5 所述的反应腔室，其特征在于，所述第二进气孔为多个，且沿所述第一凹槽的周向间隔分布；并且，所述第一凹槽的内周面在垂直于所述通孔的轴向的平面上的正投影与各个所述第二进气孔在垂直于所述通孔的轴向的平面上的正投影部分重叠。

10

7. 根据权利要求 3 所述的反应腔室，其特征在于，所述第一进气孔为多个，且间隔设置于所述第一绝缘块上。

8. 根据权利要求 3 所述的反应腔室，其特征在于，所述第二绝缘块背
15 离所述内腔（110）的一侧开设有第二凹槽，所述第二凹槽与所述法兰部件形成第二气腔，所述第二气腔分别与所述进气通道的进气端和所述进气管的出气端相连通。

9. 根据权利要求 8 所述的反应腔室，其特征在于，所述法兰部件朝向
20 所述第二绝缘块的一侧开设有第三凹槽，所述第三凹槽与所述第二凹槽对接形成所述第二气腔。

10. 根据权利要求 3 所述的反应腔室，其特征在于，所述进气机构还包括限位结构，所述限位结构设置在所述第二绝缘块的外周面与所述容纳空间
25 的内壁之间，用以限制所述第二绝缘块在所述容纳空间内转动。

11. 根据权利要求 1 所述的反应腔室，其特征在于，所述反应腔室为金

属有机化合物化学气相淀积工艺腔室。